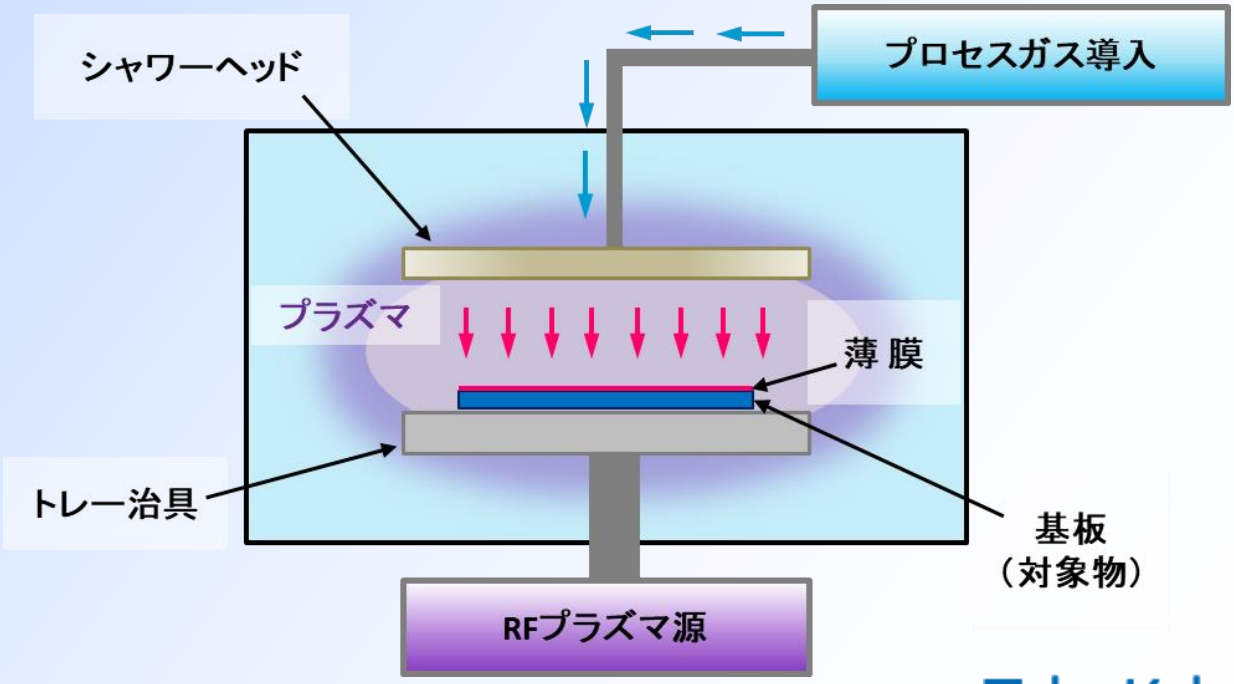
素材に新たな機能を吹き込む
真空メッキ

プラズマCVD法

プラズマCVD法は、**膜としたい元素を含むガス**を導入し、プラズマにより励起や分解をさせて、基板表面での吸着、反応等を経て膜を形成する方法です。

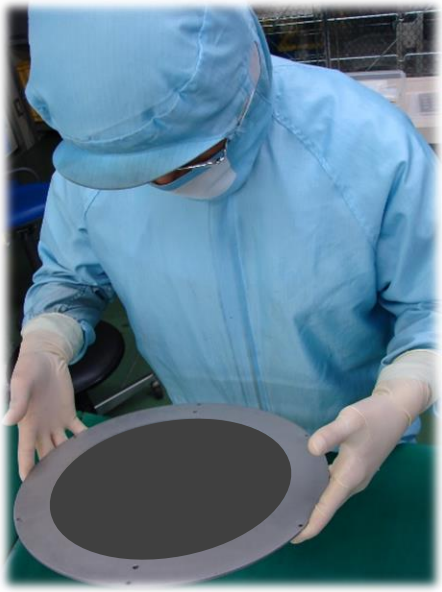
PVD法（真空蒸着・イオンプレーティング・スパッタリング）に比べて、**凹凸への付きまわりが良い**のが特徴です。



TohoKaken
ion plating

- 湿式めっき
  - 電解めっき
  - 無電解めっき
- 乾式めっき
  - 物理気相成長（PVD）
    - 真空蒸着
    - イオンプレーティング
    - スパッタリング
    - レーザーアブレーション
    - 分子線エピタキシー
  - 化学気相成長（CVD）
    - プラズマCVD
    - 熱CVD
    - 有機金属（MO）CVD
    - 光CVD

：当社保有装置で可能な薄膜作製法



TohoKaken
ion plating